

## Установка для прямого экспонирования First EIE EDI500

Установка First EIE EDI500 Direct Imager предназначена для прямого экспонирования фоторезиста и защитной паяльной маски, нанесенных на заготовку печатной платы. В устройстве используется оптика высокого разрешения, с успехом используемая в фотоплоттерах фирмы First EIE.



### Преимущества

**Швейцарское качество.**

**Высокое разрешение.**

**Простота в использовании** и обслуживании, высокий уровень надежности.

Установка компактна, занимает небольшую площадь, имеет низкое потребление энергии, легкий доступ при замене лампы. Встроенная система терморегуляции делает ненужным наличие устройства охлаждения.

**Автоматическая система регистрации и выравнивания** по сторонам A/B использует технологию распознавания изображения или по установочным меткам.

**Широкий спектр УФ-источника от 365 нм до 450 нм** делает эту установку совместимой с большинством стандартных фоторезистов и паяльных масок.

**Оптическая головка DMD** базируется на TI's DLP-чипе со встроенным активным тепловым управлением, что позволяет увеличить время жизни DMD. Специальным образом спроектированные оптические линзы оптимальны для получения наибольшей точности изображения.

### Основные характеристики:

- ✓ умный дизайн для простой регулировки головки
- ✓ модульная конструкция для легкого обслуживания
- ✓ лазерная система автоматической фокусировки
- ✓ встроенная регистрирующая камера
- ✓ вращающийся стол для лучшей регулировки панели.

**DMD технология** использует TI's DLP чип. Это дает возможность сделать установку прямого экспонирования EDI500 компактной и простой в использовании и обслуживании.

### Основные характеристики

<b>Экспонирующее устройство</b>	
Максимальный размер изображения	610 x 660 мм (24" x 26")
Размер панели	Любой размер до 610 x 720 мм (24" x 27.6") включительно
Толщина панели	от 0.1 мм до 10 мм (от 0.004" до 0.4")
Материал	Панели с фоторезистом Riston LDI и большинство других используемых в производстве, панели с защитной паяльной маской, диазопленка и фототехническая пленка Agfa CPF для работы при дневном свете
Крепление панели	First EIE вакуумный стол First EIE система прижима панели (опция)
Минимальная ширина линии	30 мкм (1.2 мил)
<b>Оптическая система</b>	
Технология	DMD с передовыми UV-линзами
Тип светового источника	Ртутная дуговая лампа очень высокого давления
Спектральная чувствительность	365 – 450 нм (UV-A)
Энергия экспонирования	от 4 до 450 мДж/см <sup>2</sup>
<b>Встроенный растровый процессор изображений</b>	
Форматы входных данных	RS274D, RS274X, DPF и EIE RPL
Опционные форматы входных данных	ODB++, PostScript, TIFF-PACKBITS, PDF
Форматы входных данных от стороннего программного обеспечения	DXE, DWG, любое другое по специальному запросу
Сетевая совместимость	Сетевая файловая система TCP-IP
<b>Пользовательский интерфейс</b>	
Дружественный пользовательский интерфейс с сенсорным экраном, программным обеспечением First EIE MPS и Remote Queue Manager Software	
<b>Выравнивание и регистрация заготовки на столе</b>	
Автоматическая регистрация заготовки и ее выравнивание по краям с помощью встроенной CCD-камеры или вручную с помощью штифтов. Уникальная система вращения стола.	
<b>Нанесение динамических серийных данных</b>	
Серийные номера, тайм-коды, штрих-коды 1D или 2D (QR-код, DataMatrix и другие) при помощи D-code карты (опция)	
<b>Время экспонирования 508 x 406 мм (для 20" x 16")</b>	Менее 90 секунд. Варьируется в зависимости от чувствительности фоторезиста и величины энергии экспонирования
<b>Точность</b>	± 15 мкм
<b>Повторяемость</b>	± 5 мкм
<b>Вес:</b>	850 кг